บรรณานุกรม

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. (2551). *เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ*. กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ. (2547). *การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2*. รายงานการวิจัยประจำปี 2547 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

มติ ห่อประทุม. (2548). *การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์,คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

สุรศักดิ์ สุรินทร์พงษ์. (2544). การชุบเคลือบผิวระบบ PVD สำหรับงานชุบเคลือบผิวเครื่องมือ (2) (จบ). *เทคนิค*, 122-125.

สุรสิงห์ ไชยคุณ, นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สกุล ศรีญาณลักษณ์ และจักรพันธ์ ถาวรธิรา. (2540). *การพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง*. รายงานการวิจัยประจำปี 2540. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา.

Atagi, L. M., Samuels, J. A., Smith, D. C., & Hoffman, D. M. (1996). Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition of Zirconium Nitride Thin Films. *Mat. Res. Coc. Symp. Proc, 410,* 289.

Bunshah, R.F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings* (2nd ed.). New Jersey: Noyes.

Bertrand, G., Savall, C., & Meunier, C. (1997). Properties of reactively RF magnetron sputtered chromium nitride coatings. *Surface & Coatings Technology, 96*, 323-329.

Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.

Chou, W.J., Yu, G.P., & Huang, J.H. (2002). Mechanical properties of TiN thin film coatings on 304 stainless steel substrate. *Surface and Coatings Technology, 149,* 7.

Hilmar, K.D., & John , H. (2007). A thermodynamic model of Z-phase Cr(V,Nb). *Computer Coupling of phase Diagrams and Thermochemistry*, *31*, 505-514.

Holleck, H. (1986). Material selection for hard coatings. *Journal of Vacuum Science & Technology A, 4,* 2661-2670.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Konuma, M., & Matsumoto, O. (1977). Some properties of zirconium nitride formed by plasmas. *Journal of the Less-Common Metals, 56*, 129.

Maissel, L.I., & Gland, R. (1970) *Handbook of Thin Film Technology*. New York: McGraw-Hill.

Munz, W.D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surf Coat Technology, 48*, 81-94.

Nose, M., Zhou, M., Honbo, E., Yokota, M., & Saji, S. (2001). Colorimetric properties of ZrN and TiN coatings prepared by DC reactive sputtering. *Surface and Coatings Technology, 142-144,* 211-217.

Prieto, Yeubero, F., Elizalde, E., & Sanz, J. M. (1996). Sputtering deposition and characterization of zirconium nitride and oxynitride films. *J. Vac. Sci. Technol. A, 14,* 3181.

Rickerby, D.S., & Matthews, A. (1991). *Advanced Surface Coatings : a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

Rohde, S.L. & Munz, W.D. (1991). *Sputter Depostion in Advanced Surface Coatings a Handbook of Surface Engineering.(pp. 103-105)*. New York: Chapman and Hall.

Sundgren, J. –E., & Hentzell, H. T. G. (1986). A review of the present state of art in hard coatings grown from the vapor phase. *J. Vac. Sci. Technol. A, 4*, 2259.

Sproul, W.D. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. In *35th Annual Technical Conference Proceedings. Society of Vacuum Coaters* (pp. 236-239).

Smith, D.L. (1995). *Thin-film deposition: principle and practice*. New York: McGraw-Hill.

Sue, J. A., & Chang, T. P. (1995). Friction and wear behavior of titanium nitride, Zirconium nitride and chromium nitride coatings at elevated temperatures. *Surface and Coatings Technology, 76-77*, 61-69.

Uchida, M., Nihira, N., Mitsuo, A., Toyoda, K., Kubota, K., & Aizawa, T. (2004) Friction and wear properties of CrAlN and CrVN films deposited by cathodic arc ion plating method. *Surface and Coatings Technology*, *177-178*, 627-630.

Urgen, M., & Cakir, A. F. (1997). The effect of heating on corrosion behavior of TiN-and CrN-coated steels. *Surf. Coat. Technol., 96*, 236-244.

Vossen, J.L., & Kerns, W. (1978). *Thin Film Processes*. New York: Academic Press.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Wasa, K., & Hayakawa, S. (1992). *Handbook of sputter deposition technology: principles, technology and applications (pp. 19-29).* New Jersey: Noyes.

Yilkiran, T., Behrens, B.-A., Paschke, H., Weber, M., & Brand, H. (2012) The potential of plasma deposition techniques in the application field of forging processes. *Archives of civil and mechanical engineering, 12,* 284-291.

Zhiguo, Z., Tianwei, L., Jun, X., Xinlu, D., & Chuang, D. (1994) Epitaxial Growth of Highly Crystalline and Conductive Nitride Films by Pulsed Laser Deposition. *Jpn. J. Appl. Phys.33,* 6308-6311.

Zenghu, Han, Jiawan, Tian, Qianxi, Lai, Xiaojiang, Yu, & Geyang Li. (2003). Effect of N_2 partial pressure on the microstructure and mechanical properties of magnetron sputtered. *Surface and Coatings Technology, 162,* 189-193.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University